587

1550

224

1150

1427

アンチモン及びその化合物標準測定分析法

構造式: Sb₂O₃ SbCl₃、Sb₂S₃、NaSbO₃·3H₂O₄ Sb

CAS No.: Sb₂O₃ 1309-64-4, SbCl₃ 10025-91-9, Sb_2S_3 1345-04-6, $NaSbO_3 \cdot 3H_2O$ 15432-85-6, Sb 7446-36-0

許容濃度等: 日本産業衛生学会: 0.1mg/m3

(Sb として, スチビンを除く) ACGIH 金属: 0.5mg/m3

物性等(Sb として)

沸点(°C): Sb-metal 分子量:121.76: Sb_2O_3 分子量:291.52: 沸点(°C): SbCl₃ 分子量:228.12: 沸点(°C): Sb₂S₃

NaSb0₂ • 3H₂0

沸点(°C): 分子量:339.72: 分子量: 246.8: 沸点(°C):

【化合物種】金属アンチモン、 酸化アンチモン(III):三酸化アンチモン、セスキ酸化アンチモン、塩化アンチモン(II):三塩化アンチモン、ト リクロロアンチモン、**アンチモン酸三ナトリウム**、アンチモン酸トリナトリウム、**硫化アンチモン(III)**;三硫化二アンチモン、輝安鉱(スティ ブナイト)

サンプリング

サンプラー : 作業環境 47mm φ

個人ばく露 35mm φ

メンブランフィルター

(AAWP04700、03500 日本ミリポア(株))

サンプリング流量: 2.0~10.0L/min

サンプリング時間: 2. OL/min 480min(8h)

10.0L/min 10min

採気量: 100L 以上

保存性:溶解後少なくとも8日間は常温で安定。 ブランク: メンブランフィルターに 10ng 程度検出

回収率

各化合物別に 78. 2-104. 5%

ICP 発光分析法

検出下限 (3σ) 0.01 μ g/mL(最終試料液濃度) 定量下限(10 σ) 0.05 μ g/mL(最終試料液濃度)

5.00µg/m³ (採気量 10L/min×10min・

最終試料液量 10mL)

0.52ug /m³ (採気量 2L/min×480min・ 最終試料液量 10mL)

ICP 質量分析法

検出下限 (3σ) 0.03ng/mL(最終試料液濃度)

定量下限(10σ) 0. 1ng/mL(最終試料液濃度)

0.01µg/m³(採気量 10L/min×10min·最終試料液 量 10mL)

0.001µg /m³ (採気量 2L/min×480min・最終試料液 量 10mL)

黒鉛炉原子吸光法

検出下限 (3σ) 1. 7ng/mL(最終試料液濃度)

定量下限(10σ)5ng/mL(最終試料液濃度)

0. 5μg /m³ (採気量 10L/min×10min・最終試料液 量 10mL)

0.05μg /m³ (採気量 2L/min×480min・最終試料液 量 10mL)

分析

分析方法:ICP 発光法、ICP 質量分析法, 黒鉛炉原子吸光法 溶解:

試料を採取したメンブランフィルターに塩酸(1+1) 4ml、過酸化水素 1 m を加え約 90℃で 30 分加熱し。冷

却後、3%塩酸を加えて10mlに定容する。

総アンチモンとして定量

機器: ICP 発光分析装置 JY2000 ULTRACE (JOBIN YVON)

ICP 質量分析装置 Agilent7700 ICP-MS (Agilent)

黒鉛炉原子吸光装置 HITACHI Z5010

ICP 発光分析装置測定条件

測定波長 217. 581nm 出力 1.0KW

プラズマガス アルゴン 1L/min

試料注入量 約 1mL/min

ICP 質量分析装置測定条件

測定質量数(m/z) 121(定量用), 123(検討用)

出力 1.4KW

キャリアーガス アルゴン 1L/min

試料注入量 約 1mL/min

黒鉛炉原子吸光装置測定条件

217. 63nm 測定波長

温度条件

dry $80 \sim 120^{\circ}$ C 60 s, ash 1000° C 10 s atom 2300° C

試料注入量 10μ L

検量線:

酸溶液(塩酸3%)で調整

黒鉛炉原子吸光法

Ong. 1.0, 3.0, 5.0, 10.0ng/mL

ICP 質量分析法

0. 0. 1. 0. 5. 1. 0. 5. 0. 10. 0. 50. 0. 100ng/mL

ICP 発光分析法

 $0, 0. 1, 0. 5, 1. 0, 5. 0, 10. 0, 50. 0, 100 \mu g/mL$

定量法:絶対検量線法

適用

妨害

参考